# 《表面技术》综述撰稿特别要求

1. 摘要要求：

中文摘要需达到400字，摘要中阐述研究背景的部分需尽量简洁，应重点详述正文内容。英文摘要与中文对照，可比中文摘要更加详细，不少于300词。

**举例：**“复合高功率脉冲磁控溅射技术的研究进展”摘要

高功率脉冲磁控溅射技术（HIPIMS）是一门新兴的高离化率磁控溅射技术。概述了HIPIMS的技术优势，包括高膜层致密度和平滑度、高膜基界面结合强度以及复杂形状工件表面膜层厚度均匀性好等。同时归纳了HIPIMS存在的问题，包括沉积速率及低溅射率金属靶材离化率低等。在此基础上，重点综述了近年来复合HIPIMS技术的研究进展，其中复合其他物理气相沉积技术的HIPIMS，包括复合直流磁控溅射增强HIPIMS、复合射频磁控溅射增强HIPIMS、复合中频磁控溅射增强HIPIMS、复合等离子体源离子注入与沉积增强HIPIMS等；增加辅助设备或装置的HIPIMS，包括增加感应耦合等离子体装置增强HIPIMS、增加电子回旋共振装置增强HIPIMS，以及增加外部磁场增强HIPIMS等。针对各种形式的复合HIPIMS技术，分别从复合HIPIMS技术的放电行为、离子输运特性，及制备膜层的结构与性能等方面进行了归纳。最后展望了复合HIPIMS技术的发展方向。

1. 正文要求：

1. 不能仅仅罗列前人所做的一些工作及结论，要针对所描述的内容提出自己的看法和评价，同时在文章中体现出前人的科研成果所作出的贡献、影响、优点与不足，已取得的研究成果是否存在一些普遍性规律。在理论研究内容介绍中，应评述各位学者所建立的模型相互之间是否存在关联性。最后展望本行业领域的发展方向。

2. 正文不低于5000字（不包含摘要和参考文献）。

3. 文献截图需标引好参考文献，要求精度足够（图片放大后，上面的文字、数据清晰），最好用专门的制图软件重新制作。

1. 参考文献：

1. 参考文献不低于50条，需有一定数量的外文文献。

2. 中文文献需有英文对照。

3. 参考文献著录格式请见附件。